

(様式第5号)

有機薄膜の光損傷の XAS による観察

XAS observation of optical damage in organic thin films

高橋 修(1), 山村 涼介(1), 小林 英一(2)

Osamu Takahashi(1), Ryosuke Yamamura(1), Eiichi Kobayashi(2)

(1) 広島大学大学院先進理工系科学研究科 (2) SAGA-LS

(1)Department of Chemistry, Graduate School of Science, Hiroshima University,
(2)SAGA-LS

- ※1 先端創生利用(長期タイプ)課題は、実施課題名の末尾に期を表す(I)、(II)、(III)を追記してください。
- ※2 利用情報の公開が必要な課題は、本利用報告書とは別に利用年度終了後2年以内に研究成果公開(論文(査読付)の発表又は研究センターの研究成果公報で公表)が必要です(トライアル利用を除く)。
- ※3 実験に参加された機関を全てご記載ください。
- ※4 共著者には実験参加者をご記載ください(各実験参加機関より1人以上)。

1. 概要 (注: 結論を含めて下さい)

LED光源による光損傷されたポリイミド薄膜の光照射劣化メカニズムを解明するため、電子収量法、蛍光収量法により炭素端のNEXAFS観察を行った。前回の測定と比較しN端の測定時間を前回の2倍にし、良質な電子収量スペクトルを得ることに成功した。

(English)

To elucidate mechanism by photo radiation, Near edge X-ray absorption fine structure (NEXAFS) spectra of polyimide film damaged by LED light have been measured at N K-edge. By extending twice of exposure time compared with the previous measurement, good total electron yield (TEY) spectra were obtained for the sample thickness of 7.5 μm .

2. 背景と目的

昨今の材料開発は分子レベルにおける種々の外場制御が求められている。分子レベルによる変化を観測することは材料の耐久性を考慮する上で重要な知見を与える。特に電子状態変化を分子レベルで直接観測できるXAS法はこうした変化を調べる最適の手法の1つである。我々は特に実際に使用されている実材料の状態変化に特に興味を持っている。

我々は特にポリイミドの光損傷に着目した。ポリイミド(カプトン)は繰り返し単位にイミド結合を有する高分子の総称であり、イミド結合を介して共役結合を持つために、剛直で強固な分子構造を持つうえ、イミド結合が強い分子間力を持つために高い耐熱性、機械特性を有し、化学的に安定である。

ポリイミドの光損傷に対する研究報告は濱田らによる国内学会[1]があるのみで、欧文誌による報告例はない。また膜厚100nm程度のポリイミド薄膜のNEXAFS測定は、Tanakaら[2]、Sakaiら[3]、Sedlmairら[4]によって報告されている。本研究では先行研究より実材料の利用条件に近い条件を目指し、光源にはLED光源を用いて光損傷を与えたポリイミド膜を作成し、電子収量法、蛍光収量法に

よる X 線吸収分光 (XAS) 測定を行うことで表面の劣化を観察した。本年度 12 月に XAS 測定を行い、測定条件の洗い出しを行った。今回は前回と同じ膜厚 7.5 μm のサンプルを用い、特に光損傷を議論するうえで重要となる N 端のスペクトルの S/N 向上を目的とし、露光時間を倍にした。

3. 実験内容 (試料、実験方法、解析方法の説明)

試料はポリイミド膜として、7.5 μm のものを使用した。ポリイミド膜に光損傷を与えるため、光源として HAYASHI 製の LED 光源を用い、フィルムに直接光を照射した。光照射は、24 時間、33 時間、40 時間、48 時間、96 時間、240 時間連続で行った。それぞれの試料はあらかじめ実験室において顕微鏡観察、IR 測定を行い、試料損傷があることは確認した。

NEXAFS 測定は BL12 に設置されている XPS/NEXAFS 装置を用い、炭素、窒素、酸素の K 端の全電子収量法と全蛍光収量法によって室温で行った。試料はカーボンテープで固定した。測定範囲は C K 端スペクトルはおよそ 280~340 eV、N K 端スペクトルおよそ 380-440 eV、O K 端スペクトルおよそ 525-580 eV を 0.1 eV~1 eV 間隔で測定した。

4. 実験結果と考察

図 1 に今回測定した polyimide の N K 端における全電子収量法 (TEY)、全蛍光収量法 (TFY) における NEXAFS スペクトルを示す。先行研究として、薄膜 (100 nm 以下) の NEXAFS スペクトルがすでに報告されている [2,3]。前回の測定 (2020 年 12 月) と比べ、露光時間を各ステップで 20 秒から 40 秒へ 2 倍に延ばしたため、S/N が格段に向上した。ビームダメージの影響はみられない。縦線を示したピークが特徴的なピークである。現在帰属を検討中である。TFY のスペクトルは文献 [2] のものと類似しており、よいスペクトルが得られたと考えている。

研究室における IR 測定でも確認していたが、ダメージを与えていないサンプルと 24h のものの間にはあまり差はないが、48h 以上照射したものとは特に C K 端の TEY の 285 eV 付近のスペクトル形状に顕著な違いが見られる。照射初期に主鎖の切断によりラジカルが生成し、その後空気中の酸素もしくは水と反応しているのではないかと推察している。

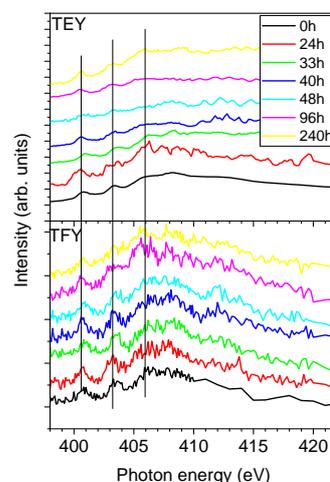


図 1: NEXAFS spectra of polyimide at N K-edge.

5. 今後の課題

膜厚 7.5 μm のポリイミド薄膜を用い、NEXAFS 測定を行った。N K 端でのスペクトルの S/N 向上を目指し、露光時間を前回の 2 倍に設定した。S/N はかなり向上し、特に TFY では先行研究のスペクトルと類似したものが得られた。TEY ではまだチャージアップの影響をさけるための更なる努力が必要である。より膜厚の薄いサンプルを用いるなどの工夫を計画している。また新たな試みとして照射しながら TFY を取得することにより、ポリイミドの光損傷メカニズムの解明を目指す。

6. 参考文献

- [1] 濱田ら, 第 13 回宇宙科学シンポジウム, 宇宙科学研究所(2013).
- [2] T. Tanaka et al, Anal. Sci., **17**, i1077 (2001).
- [3] T. Sakai et al, J. Phys. Chem. B, **105**, 9191 (2001).
- [4] J. Sedlmair et al, J. Soils Sediments, **12**, 24 (2012).

7. 論文発表・特許 (注: 本課題に関連するこれまでの代表的な成果)

- [1] O. Takahashi et al, AIP Advances **8**, 025107 (2018).
- [2] N. Nishida et al, Chem. Phys. Lett. **649**, 156 (2016).
- [3] N. Nishida et al, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. **220** (Supplement C), 96 (2017).

8. キーワード (注: 試料及び実験方法を特定する用語を 2~3)

9. 研究成果公開について（注：※2に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文（査読付）発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください。提出期限は利用年度終了後2年以内です。例えば2018年度実施課題であれば、2020年度末（2021年3月31日）となります。

長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

① 論文（査読付）発表の報告 （報告時期： 2022 年 3 月）